周期加熱法による薄膜の熱拡散率異方性測定装置の構築

岡本 和也, 阿武 宏明

山陽小野田市立山口東京理科大学 工学部 電気工学科

Fabrication of Anisotropic Thermal Diffusivity Measurement System for Thin Films by an AC Calorimetric Method

Kazuya Okamoto and Hiroaki Anno

Department of Electrical Engineering, Tokyo University of Science, Yamaguchi

要 約

近年,有機系薄膜熱電材料の研究が活発に進められているが,有機系材料の熱電特性には異方性があることが 知られている.しかし,ゼーベック係数および電気伝導率は膜面内方向,熱伝導率は膜面直方向の値の報告が多 い.熱伝導率を測定する方法としてフラッシュ法や3ω法などがあるが基本的に面直方向の測定であり,測定で きる試料の膜厚の制限や面内熱伝導率は解析的に求めるなどの課題があった.一方,周期加熱法は同一試料の面 内熱伝導率および面直熱伝導率の両方を測定可能な手法である.そこで本研究では,レーザー光を用いた周期加 熱法による熱伝導率の測定装置の構築を行い,高分子膜の熱伝導率の異方性を評価した結果について報告する.

キーワード:周期加熱法,熱拡散率,異方性,ポリイミドフィルム

I. 研究背景

近年. 200℃以下の低温度レベルの排熱や自然熱や 体温などの未利用熱エネルギーを直接電気エネルギー に変換して発電を行う有機熱電材料が注目され、熱電 特性であるゼーベック係数、電気伝導率および熱伝導 率から定義される無次元熱電性能指数 ZT が向上して いる¹⁻⁶⁾. 有機熱電材料は大面積での作製が容易であ り、環境への負荷が少なくフレキシブル性があること から熱配管のような熱源が曲面の形状をしている対象 への設置も可能であり、辺境地における独立電源やき たるべき IoT の要素技術であるセンサネットワークに おけるセンサ独立電源としても注目されている. 有機 系薄膜熱電材料には熱電特性の異方性があることが知 られているが、ゼーベック係数および電気伝導率は面 内方向,熱伝導率は面直方向の測定結果を用いた ZT の報告が多く、方向を一致させた ZT の評価が必要と されている.熱拡散率を測定する手法として多く用 いられているフラッシュ法は7),測定試料の厚さが十 数 µm 程度以上必要であること, パルス光による加熱 面と温度変化を計測する検出面が異なり基本的に面直 方向の熱拡散率測定であり、面内方向の熱拡散率は特 殊な配置による計測をして面直方向の熱拡散率の値を 使用して解析的に面内熱拡散率を求めなければならな い問題点があった.また、薄膜の熱拡散率測定手法で ある3ω法は^{8),9)}, 膜厚が100 nm 程度の試料に対して 用いられる測定方法であり,基本的に面直方向の熱拡 散率測定であり、フラッシュ法同様に面内方向の熱拡 散率は特殊な配置により解析的に面内熱拡散率を求め る必要がある.また、試料表面に絶縁層を形成し、そ の上に金属細線をパターニングする必要がある. 試料 表面が粗い場合、絶縁層および金属細線を形成できな いため3ω法では測定できないなどの問題点があった.



Fig. 1 Schematic diagram of measurement theory by an AC calorimetric method.

周期加熱法では試料表面の一部を周期的に加熱し,加 熱点から距離 x 離れた点の温度応答の振幅もしくは位 相差から熱拡散率を求める方法であり,加熱面と同じ 面で温度変化を計測することから面直方向の熱拡散率 に関係なく面内熱拡散率の測定が可能である. さら に,同一試料で加熱点から試料厚さ d 離れた点の温度 応答の振幅もしくは位相差から面直熱拡散率を求める ことができる.

そこで本研究では周期加熱法を用いた薄膜の熱拡散 率異方性を測定する装置の構築,さらに測定精度およ び適用範囲などの検討を行った結果について報告す る.

Ⅱ. 周期加熱法の原理

本研究では、Hatta ら¹⁰⁾ および Hagino ら¹¹⁾ の論文を 参考に周期加熱法による熱拡散率測定装置を作製し



Fig.2 Schematics of measurement method of thermal diffusivity for (a) in-plane direction and (b) throughplane direction.

... (1)

た. Fig. 1に周期加熱法による測定原理の模式図を示 す. 周期発振のレーザーを試料表面に照射して周期加 熱(周波数f)を行い,照射点から距離xの位置の温 度T(x)を検出する. 試料の膜厚dは熱拡散長mに対 して充分に薄い場合,つまり

 $md \ll 1$

の場合を考える.熱拡散長mは

$$m = \sqrt{\frac{\pi f}{\alpha}} \qquad \cdots \qquad (2)$$

で与えられる.ここで,αは熱拡散率である.

面内方向(x方向)の位置xにおける温度は次の1次 元の熱伝導方程式を解いて得ることができる.

$$\rho cd \frac{\partial T}{\partial t} + \delta T - \kappa d \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = Q(x, t) \qquad \cdots \qquad (3)$$

ここで ρ は密度, cは比熱, κ は熱伝導率, δ は熱伝 達率である. Q(x,t) はレーザーによる周期加熱の入 熱量であり, x=0における入熱量Q(t) は,

$$Q(t) = Qe^{i\omega t} \qquad \cdots \qquad (4)$$

で与えられる. (3)式を温度 T について解くと,

$$T(x) = \frac{Q}{2(i2\pi f\rho cd + \delta)} \cdot \exp\left(-\sqrt{\frac{i2\pi f\rho cd + \delta}{\kappa d}}x\right) \qquad \dots (5)$$

ここで外部緩和時間をτとすると,

$$\tau = \frac{\rho c d}{\delta} \qquad \qquad \cdots \quad (6)$$

とし、式を書き直すと、

$$T(x) = \frac{Q}{i4\pi f\rho cd \left\{1 - i\left(\frac{1}{2\pi f\tau}\right)\right\}} \cdot \exp\left[-\sqrt{i\frac{2\pi f}{\alpha} \left\{1 - i\left(\frac{1}{2\pi f\tau}\right)\right\}}x\right] \quad \dots \quad (7)$$

ここで,

 $2\pi f \tau >> 1$... (8)

となる場合, (7)式は以下のように変形できる.

$$T(x) = \frac{Q}{4\pi f\rho cd} \exp\left\{-mx - i\left(mx + \frac{\pi}{2}\right)\right\} \qquad \cdots \qquad (9)$$

$$m = \sqrt{\frac{\pi f}{\alpha_{\prime\prime}}} \qquad \cdots \qquad (10)$$

面内方向の熱伝導において,(9)式から周期加熱点 と温度測定点 x との温度の位相差は次式から求められ る.



Fig.3 Measurement system of thermal diffusivity by an AC calorimetric method.

$$\theta = \sqrt{\frac{\pi f}{\alpha_{\prime\prime\prime}}} x \qquad \cdots \qquad (11)$$

(11)式より,周波数fにおいて位置xを変化させて 位相差θを測定し,位相差θと位置xの関係の勾配か ら面内熱拡散率が求められる(Fig. 2(a)).

同様に面直方向の熱伝導において,周期加熱点と温 度測定点(y=d)との温度の位相差は次式から求めら れる.

$$\theta = d\sqrt{\frac{\pi}{\alpha_{\perp}}}\sqrt{f} \qquad \cdots (12)$$

(12) 式より, 試料厚さ*d* (周期加熱点の試料裏面位 置) における位相差 θ を周波数fを変化させて測定 し, 位相差 θ と周波数 \sqrt{f} の関係の勾配から面直熱拡 散率が求められる (Fig.2(b)). 面内および面直熱伝 導率は熱拡散率 α , 密度 ρ および比熱cから, $\kappa = \alpha \rho c$ により算出する.

Ⅲ. 装置構成と測定手法

Fig. 3に作製した測定装置の外観を示す. ファンク ションジェネレータ (Tektronix, AFG3022G) から出 力した矩形波を入力信号として周期発振したレーザー 光 (Omicron, LuxX+633-100, 波長 λ =633 nm, 80 mW) は戻り光からレーザーを守るためのアイソレー

タ(Electro-Optics Technology, ISO-04-650-LP-W) を 経て顕微鏡ユニット (Nikon, ECLIPSE LV150N) の 対物レンズによって集光し、 試料を周期加熱する. 試 料表面の温度変化は K 型熱電対(直径 $\phi = 25 \mu m$)を 用いて検出し、各40dBの増幅器を2つ使用(エヌエフ 回路設計ブロック nF, SA-400F3および SA-200F3) す ることによって温度シグナルを増幅しロックインア ンプ (NF ELECTRONIC INSTRUMENT, 5600A single phase lock-in amplifier) に入力, ファンクションジェ ネレータの出力波形と測定温度シグナルの位相差を測 定する.なお、2段の増幅器の電源にはそれぞれ低雑 音直流電源(nF, LP5392)を用いた. 試料表面に集 光によって得られているレーザーの径は30 µm 程度で ある.装置検証のための試料としてポリイミドフィル ム (UBE, UPILEX 25S, サイズ25×25 mm, 膜厚 d =25±0.42 µm)を使用した.

面内熱拡散率の測定では、周期発振(周波数 f = 15 Hz 一定)したレーザー光により試料表面を局所的 に周期加熱し、加熱位置から距離 x 離れた位置の温度 変化を熱電対により読み取りレーザー発振と測定温度 との位相差を取得した.試料を設置した試料ホルダ・ ステージの x 方向を動かすことで各位置 x における位 相差を取得して、位相差 – 位置の関係から面内熱拡 散率を算出した.面直熱拡散率の測定では、温度変化



Fig.4 Measurements of thermal diffusivity of (a) in-plane direction and (b) through-plane direction for a polyimide film.

を測定する熱電対を取り付けた試料の裏面にレーザー 光を照射しレーザー発振と測定温度との位相差を取 得した.レーザー発振周波数を変化(周波数f=17-31 Hz)させ各周波数における位相差を取得して、位 相差 – \sqrt{f} の関係から面直熱拡散率を算出した.なお、 全ての測定は、大気中、室温付近(20℃)で行った.

Ⅳ. 実験結果

Fig. 4にポリイミドフィルムの熱拡散率の異方性を 測定した一例を示す. 面内方向の位相差 - 位置の関係 および面直方向の位相差 – √ の関係はともに直線関 係であることがわかる.本測定結果から面内熱拡散 率は0.78 mm²/s, 面直熱拡散率は0.16 mm²/s であった. 密度および比熱をそれぞれ1.47 g/cm³, 1.13 J/(gK) と して熱伝導率を算出した¹²⁾. 面内および面直熱伝導率 は1.30 W/(mK) および0.26 W/(mK) であった. Table 1 に本測定装置での熱拡散率の測定結果、比較として周 期加熱法によりベテルハドソン研究所における厚さ25 umのポリイミドフィルムの熱拡散率の測定結果¹³⁾. および参考までに、本手法とは異なる測定法の熱伝導 率の文献値を示す14).括弧内は、報告されている熱拡 散率および熱伝導率と今回使用した密度および比熱か ら、それぞれ熱伝導率と熱拡散率を計算した値であ る. 周期加熱法で同一膜厚の結果であるベテルハドソ ン研究所の値に対して、本測定結果は、面内熱拡散率 は相対誤差2.5%, 面直熱拡散率は相対誤差6.7% でよ く一致している.

(1)および(8)式より適用範囲は試料の比熱,密度,厚み,熱伝達率,および周波数によって決まる. 本測定のポリイミドフィルムの場合,(1)をほぼ満たしている.また,空気の熱伝達率は10 W/(m²K)程度であるため,本測定のポリイミドフィルムの場合,(8)式をほぼ満たしている.Fig.5にポリイミドフィ



Fig. 5 Relation between frequency and thickness based on Eq.(8) for polyimide.

	Thickness - <i>t</i> [μm]	Thermal diffusivity		Thermal conductivity	
		In-plane α _{//} [mm²/s]	Through-plane α_{\perp} [mm ² /s]	In-plane ĸ" [W/(mK)]	Through-plane κ_ [W/(mK)]
This work	25	0.78	0.16	1.30	0.26
Ref. 13	25	0.80	0.15	(1_33)	(0.25)
Ref. 14	1.4	(0.85)	(0.14)	1.42	0.24

ルムを対象に熱伝達率を10 W/(m²K) としたとき膜厚 に対して必要な周波数を(8)式の値が100として描いた.

V. 謝辞

本研究は新エネルギー・産業技術総合開発機構の助 成を受けたものであり日本ゼオン株式会社との共同研 究による成果である.

Ⅵ. 参考文献

- 1) H. Yan, and N. Toshima, "Thermoelectric Properties of Alternatively Layered Films of Polyaniline and (±)-10-Camphorsulfonic Acid-Doped Polyaniline", Chem. Lett., 28, 1217-1218, 1999.
- 2) S. K. M. Jönsson, J. Birgerson, X. Crispin, G. Greczynski, W. Osikowicz, A. W. Denier, van der Gon, W. R. Salaneck, and M. Fahlman, "The Effects of Solvents on the Morphology and Sheet Resistance in Poly (3,4-ethylenedioxythiophene) -polystyrenesulfonic Acid (PEDOT-PSS) Films", Synth. Metal., 139, 1-10, 2003.
- 3) O. Bubnova, Z. U. Khan, A. Malti, S. Braun, M. Fahlman, M. Berggren, and X. Crispin, "Optimization of the Thermoelectric Figure of Merit in the Conducting Polymer Poly (3,4-ethylenedioxythiophene)", Nat. Mater., 10, 429-433, 2011.
- 4) G-H. Kim, L. Shao, K. Zhang, and K. P. Pipe, "Engineered Doping of Organic Semiconductors for Enhanced Thermoelectric Efficiency", Nat. Mater., 12, 719-723, 2013.
- 5) N. Toshima, K. Oshima, H. Anno, T. Nishinaka, S. Ichikawa, A. Iwata, and Y. Shiraishi, "Novel Hybrid Organic Thermoelectric Materials: Three-Component Hybrid Films Consisting of a Nanoparticle Polymer Complex, Carbon Nano-

tubes, and Vinyl Polymer", Adv. Mater., 27, 2246-2251, 2015.

- 6) C. Wan, X. Gu, F. Dang, T. Itoh, Y. Wang, H. Sasaki, M. Kondo, K. Koga, K. Yabuki, G. J. Snyder, R. Yang, and K. Koumoto, "Flexible n-type Thermoelectric Materials by Organic Intercalation of Layered Transition Metal Dichalcogenide TiS2", Nat. Mater., 6, 1-6, 2015.
- 7) W. J. Parker, R. J. Jenkins, C. P. Butler, and G. L. Abbott, "Flash Method of Determining Thermal Diffusivity, Heat Capacity, and Thermal Conductivity", J. Appl. Phys., 32, 1679-1684, 1961.
- 8) D, G. Cahill and R. O. Pohl, "Thermal Conductivity of Amorphous Solids Above the Plateau", Phys. Rev. B, 35, 2674-2677, 1985.
- 9) N. O. Birge, "Specific-Heat Spectroscopy of Glycerol and Propylene Glycol Near the Glass Transition", Phys. Rev. B, 34, 1631-1642, 1986.
- 10) I. Hatta, Y. Sasuga, R. Kato, and A. Maesono, "Thermal Diffusivity Measurement of Thin Films by Means of an AC Calorimetric Method", Rev. Sci. Instrum., 56, 1643-1647, 1985.
- 11) H. Hagino, M. Hokazono, H. Anno, N. Toshima, and K. Miyazaki, "Thermal Transport Properties of PEDOT-PSS Thin Films", Proceedings of the 15th International Heat Transfer Conference. 3-10, 2014.
- 12) UBE industries ltd, Upilex URL:http://www.upilex.jp/jp/upilex_grade.html
- 13) ベテルハドソン研究所, 熱物性ブログ, URL: http://blog.thermal-measurement.info/archives/ 51719243.html
- 14) Y.S. Ju, K. Kurabayashi, and K.E. Goodson, "Thermal Characterization of Anisotropic Thin Dielectric Films Using Harmonic Joule Heating", Thin Solid Films, 339, 160-164, 1999.